

# ナノ・マイクロ構造による熱輻射制御の原理

髙原 淳一

大阪大学大学院 工学研究科(〒 565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-1) 大阪大学 工学研究科附属フォトニクスセンター(兼)(〒 565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-1)

## Principles of Thermal Radiation Control by Nano/Micro-Structures

## Junichi TAKAHARA

Graduate School of Engineering, Osaka University, 2-1 Yamadaoka, Suita, Osaka 565-0871 Photonics Center, Osaka University, 2-1 Yamadaoka, Suita, Osaka 565-0871

#### (Received December 20, 2022)

This paper comprehensively overviews the principles of thermal radiation control by nano/micro-structures. First, we review the history of thermal radiation control, starting from the spontaneous emission of atoms placed in a microcavity. Next we discuss the effects of a microcavity and surface waves on thermal radiation. Finally, the narrow and wideband perfect absorbers based on metamaterials/metasurfaces are discussed.

Key Words: Thermal radiation, Microcavity, Perfect absorber, Metamaterial, Super-Planckian

## 1. はじめに

持続可能な社会の実現に向けて,社会のあらゆる分野 において省エネルギー,省資源化がすすめられている. そこで重要になるのが熱の制御である.熱はエネルギー 形態の一つであるから消すことはできないが,熱伝導, 熱輻射,対流によって空間を移動させる(伝熱(heat transfer)),あるいは別の形態に変換する(エネルギー変 換)ことができる<sup>1)</sup>.伝熱やエネルギー変換をナノテク ノロジーの視点から見直すことで自在に制御できれば, 省エネルギー化の飛躍的な進展が期待できる.

熱輻射はプランクの法則にしたがうブロードなスペク トル分布をもつ.これを光源としたものが白熱電球やハ ロゲン電球などの熱輻射光源である.現在,照明の分野 では白熱電球から LED への置き換えがすすめられてい るが,熱輻射光源は効率が低いとして簡単に切り捨てる にはおしい優れた特徴を持っている.一般に熱には温度 (熱力学温度 T)しかなく,光と異なりスペクトルをもた ないので制御が非常に難しい.しかし,熱輻射を利用し て熱を光にエネルギー変換(熱光変換)すると,光のもつ スペクトルにより制御が容易になる.熱光変換により熱 は「飛び道具」に化けるので,熱伝導に比べてはるかに遠 方への伝熱を光速度でできる<sup>2)</sup>.また,熱輻射のエネル ギー変換効率は極めて高い.例えば,真空断熱された古 いタイプの白熱電球(エジソン電球)の電力から輻射パ ワーへの変換効率は 90% をこえる<sup>3,4)</sup>.

2000年以降のナノテクノロジーの発展により熱輻射

スペクトルや偏光の制御が可能となり、この分野は熱輻 射制御(thermal radiation control)とよばれるようになっ た<sup>2,3,5-7)</sup>.ナノ・マイクロ共振器、フォトニック結晶や メタマテリアルにより、特定の波長または帯域に熱輻射 パワーを集中させることで、可視~赤外の広い波長域に わたる高効率の狭帯域熱輻射光源を実現できる。また、 熱励起された表面波(surface wave)により指向性の高い 単色の熱輻射が得られている<sup>8)</sup>.波長より十分小さな距 離だけ離れた物体間の輻射伝熱(radiative heat transfer)が プランクの法則の限界を超えることも実証された<sup>9)</sup>.こ れらは半導体光源の少ない赤外~テラヘルツ域の光源、 熱光起電力(thermophotovoltaic: TPV)発電や放射冷却な ど広い分野への応用が期待されている<sup>10)</sup>.

最近,遠方場においてもプランクの法則の限界を超え る輻射伝熱が観測されたという報告がある<sup>11)</sup>.これは熱 力学の基本法則を破ることから,基礎的な面からその解 釈をめぐる議論が続いている<sup>12)</sup>.

本稿ではチュートリアル的な観点からナノ・マイクロ 構造を用いた熱輻射制御の原理について述べる.はじめ にプランクの法則から熱波長を定義し,近接場と遠方場 を区別する.遠方場の輻射伝熱についてマイクロ共振器 中の原子の自然放出の研究から熱輻射制御にいたる歴史 を概観する.共振器中の光の定在波や表面波が遠方場の 熱輻射スペクトルにおよぼす効果について議論する.最 後にメタマテリアルやメタサーフェスによって完全吸収 体を構成するための原理の違いについて述べ,熱輻射光 源の実例を紹介する.

## 2. キルヒホッフの法則とプランクの法則

黒体(blackbody)とはあらゆる波長の光を吸収する仮 想的な物体のことをいう.現実にはこのような物体は存 在しないので空洞にあけた穴が黒体として利用される (Fig.1(a)). Fig.1(a)では温度Tの空洞壁とそれと熱平 衡状態にある空洞中の光(フォトン)を考える(空洞内は 真空とする).壁は吸収をもつ物体とする.壁に小さな 穴をあけ,空洞中の光を外部に取り出したものが黒体輻 射である.

キルヒホッフの法則によれば「空洞壁を構成する物体 の分光発散度(分光放射能とよばれることもある)と分光 吸収率の比は物体の性質によらず一定である.その比は 物体と熱平衡状態にある空洞内の輻射の分光発散度に等 しい」である<sup>1,13,14)</sup>.これを式で書くと

$$\frac{E(\omega)d\omega}{A(\omega)} = E_{\rm bb}(\omega)d\omega \tag{1}$$

となる.ここで、 $E(\omega) d\omega$  W/m<sup>2</sup> は角周波数 $\omega$ における 空洞壁からの分光発散度、 $A(\omega)$ は壁の分光吸収率(spectral absorptivity)、 $E_{bb}(\omega) d\omega$  W/m<sup>2</sup> は空洞中の輻射の分光 発散度である.量子力学によれば $E_{bb}(\omega) d\omega$  は以下のプ ランクの法則にしたがう.

$$E_{\rm bb}(\omega)d\omega = \frac{\hbar}{4\pi^2 c^2} \frac{\omega^3}{\exp(\hbar\omega/k_{\rm B}T) - 1}d\omega \qquad (2)$$

ここで、 $h = h/2\pi$ , hはプランク定数, cは光速度,  $k_B$ はボルツマン定数である.式(2)の唯一のパラメータは Tであり、それ以外は自然定数で決まるので制御できな い.しかし、現実の物体表面(実在面)の熱輻射は黒体輻 射からずれている。そこで黒体輻射と実在面からの分光 発散度の比として分光輻射率(spectral emissivity) $\varepsilon'(\omega) = E(\omega)/E_{bb}(\omega)$ を定義する(伝熱工学では輻射率を $\varepsilon$ で表 すが、本稿では誘電率と区別するために'をつけた). 式(1)は分光輻射率を用いると $\varepsilon'(\omega) = A(\omega)$ と書ける(キ ルヒホッフの法則はこの形で表現されることが多い). したがって実在面からの熱輻射スペクトルを制御するに は材料や表面の状態を変えて吸収スペクトルを設計すれ ばよい.



Fig. 1 (a) Blackbody radiation from a small hole on a macroscopic cavity (>> $\lambda = 2\pi c/\omega$ ), and (b) spontaneous emission from a single atom inside a micro-cavity (~ $\lambda$ ). The atom is placed on the node or the anti-node of a resonant mode of light.

黒体輻射はあらゆる波長の光を含む白色光で特定の波 長がない.これは近接場の領域を定めるうえで問題とな る.そこで黒体輻射のピーク波長を熱輻射の波長とする のが良い.式(2)をωで微分してピーク角周波数を求め, それを波長に換算するとピーク波長λ<sub>max</sub>は,

$$\lambda_{\max} \approx 2.23 \frac{\hbar c}{k_{\rm B}T} = 2.23 \lambda_{\rm T}$$
 (3)

となる.ここで長さの次元を持つ量として熱波長(thermal wavelength)

$$\lambda_T = \frac{\hbar c}{k_{\rm B}T} \tag{4}$$

を導入した<sup>2,14)</sup>.  $\lambda_{T}$ は黒体輻射のピーク波長とほぼ等しく,熱輻射の特性波長として用いることができる.こうすると熱輻射光源から $\lambda_{T}$ より十分はなれた領域(>> $\lambda_{T}$ )を遠方場(far field),十分小さい領域(<< $\lambda_{T}$ )を近接場(near field)として区別できる.

式(2)を全周波数において積分すると黒体の全放射発 散度(全放射能ともよばれる) $E_{bb}$  W/m<sup>2</sup> と Tの関係式と して以下のステファン・ボルツマンの法則が得られ る<sup>1,14)</sup>.

$$E_{\rm bb} = \sigma T^4 \tag{5}$$

ここで、 $\sigma = \pi^2 k_{\rm B}^4 / 60 c^2 \hbar^3$ はステファン・ボルツマン定数( $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \, {\rm Wm^{-2} \, K^{-4}}$ )である.

いま平板の黒体 1 と黒体 2 が距離 *d* だけ離れて平行に 向き合っているとする.  $\lambda_{T}$ に比べて十分離れた遠方場 (*d*>> $\lambda_{T}$ )にある 2 つの黒体 1 (温度  $T_{1}$ )と黒体 2 (温度  $T_{2}$ ) の間の正味の輻射伝熱は  $E_{net} = \sigma(T_{1}^{4} - T_{2}^{4})$ で与えられ, この黒体輻射の値を超えることはできない. 伝熱工学の 視点から式(5)の  $E_{bb}$  は遠方場で Tにおいて熱輻射によ り取り出し可能な最大のエネルギー束を与える. 近接場 (*d*<< $\lambda_{T}$ )では 2 つの黒体間でエバネッセント波(トンネ リングフォトンと解釈できる)による伝熱がおきるから, その寄与を考慮する必要がある. 黒体表面のエバネッセ ント波の平行方向の最大波数をカットオフ波数  $\beta_{c}$ とお くと輻射伝熱におけるエネルギー束のエバネッセント波 の寄与分  $E_{bb}^{cwa}$  は

$$E_{\rm bb}^{\rm eva} = \frac{k_{\rm B}^2 T^2 \beta_{\rm c}^2}{24\hbar} \tag{6}$$

と書ける<sup>15)</sup>. カットオフ波数を波長に換算して $\lambda_c = 2\pi/\beta_c$ とおき,式(6)と式(5)の比をとると伝搬波に対するエバ ネッセント波の寄与の割合は

$$\frac{E_{bb}^{eva}}{E_{bb}} = 10 \left(\frac{\lambda_{\rm T}}{\lambda_{\rm c}}\right)^2 \tag{7}$$

となる. Fig. 2 から $\lambda_{\rm T}$  は温度にもよるがおおむねオー ダー10<sup>-6</sup> ~ 10<sup>-3</sup> m 程度である.具体例として例えば SPP (Surface Plasmon Polariton)の取りうる最小波長のオー ダー $\lambda_{\rm c}$  ~ 10<sup>-8</sup> m とすれば式(7)は 10<sup>5</sup> 以上の値となる. 近接場輻射伝熱においてエバネッセント波の寄与は伝搬



Fig. 2 Thermal wavelength vs. temperature: Gray area is the region which is one order shorter than  $\lambda_{T}$ .

波に比べて桁違いに大きく,輻射伝熱はステファン・ボ ルツマンの法則の限界 Ebb を大きく超える.これをスー パープランキアン(super-Planckian)とよぶ.この現象は 近接場輻射伝熱と呼ばれている.

Fig. 2 に $\lambda_{T}$ の温度依存性を示す<sup>14)</sup>. 灰色は熱波長よ り一桁小さい $\lambda_{T}$ /10 以下の領域を示し,近接場の目安と なる.室温 300 K では $\lambda_{T} \sim 10 \mu m$  であり,近接場は 1  $\mu m$  以下のサブミクロン空間以下であるからマクロな 系は遠方場として扱うことができる.しかし,微細化が 著しい電子集積回路では近接場輻射伝熱を考慮する必要 がある.液体 He 温度(4.2 K)では $\lambda_{T} \sim 1 \, \text{mm}$  であり, 100  $\mu m$  の距離でも近接場に入り,さらに極低温におい ては $\lambda_{T} \sim \text{cm}$  となるからマクロな系でも近接場輻射伝熱 を扱う必要がある.

#### 3. 共振器 QED から熱輻射制御へ

孤立原子からの自然放射(spontaneous emission)はその 原子に備わった自然の性質と考えられていた.しかし, Purcell は原子からの自然放射はその原子の置かれた外 部環境(共振器)により変化することを指摘した16).特 に原子の置かれた空間のサイズが光の波長**λ**程度にな ると, 空間が共振器となるために自由空間中の原子と比 較して自然放射が抑制(自然放射レートの低下)されたり, 逆に増幅(自然放射レートの増大)されたりする(Fig.1 (b))<sup>17-19)</sup>.単一原子からの放射の場合はこの効果は共振 器量子電気力学(QED)効果として知られている.これ は単に共振器中の電磁場の共振モードの励起だけではな いおもしろさを含んでいる。この現象が興味深いのは、 光(フォトン)の放出が起きる前の状態(光子数ゼロ)では、 励起原子は共振器の存在を認識できないにもかかわらず, 共振器を感じて放射レートを調整しているように見える ことである. これは光子数ゼロでも共振器中にはフォト ンのゼロ点エネルギーによる真空場ゆらぎ(vacuum filed fluctuation)が存在し、励起原子がこれを感じるためと解 釈される20).

1980~90年代にかけて自然放射は原子と真空場の結 合系の性質であることが広く認識され、単一原子だけで なく、有機分子や半導体においても発光寿命の変化が観 測された.また,この効果が半導体レーザー(LD)や LEDの性能向上,特にレーザー発振閾値の低減に応用 できることが指摘され,応用研究が活発化した<sup>21)</sup>.1990 年代以降の半導体微細加工技術の発展により共振器のQ 値はフォトニック結晶(Photonic Crystal: PC)中のナノ光 共振器により極めて高いものが実現され,閾値の低減が 実証されている<sup>20,22)</sup>.最近,プラズモニックナノレーザー においてもナノ光共振器による大幅な閾値低下が観測さ れた<sup>23)</sup>.

熱輻射も自然放射の一つであるから、共振器で制御で きると考えるのは自然であろう.熱輻射制御に用いられ る構造の例を Fig. 3 に示す. 1986 年には Fig. 3 (a) に示 すような深い回折格子を固体表面に形成することにより, 回折格子の溝が開口型共振器となって熱輻射スペクトル が共振的に増大することが観測された<sup>24)</sup>.これはマイ クロ共振器による熱輻射制御の最初の例である.また、 マイクロ共振器の赤外線カットオフ効果を利用したフィ ラメントによる白熱電球の高効率化のアイデアもこの時 期に提案されている<sup>25)</sup>. 2000 年代に入ると 2 次元に並 べたマイクロ共振器(Fig. 3 (b))による熱輻射制御の実験 が多数行われ、熱輻射が制御できることが確認され た<sup>26-29)</sup>.これらの構造は現在からみると後述するメタ サーフェスの一種といえるが、当時はマイクロ共振器ア レイ (Micro-Cavity Array: MCA)とよばれていた.

MCA 中の光のモードは離散的にはなるが完全にモードがなくなるわけではない. 共振器 QED の視点から PC の完全フォトニックバンドギャップ (Photonic Band Gap: PBG)を用いると熱輻射を完全に抑制できると期待された. MCA に続いて, Fig. 3(c) に示す 3 次元 PC(ウッドパイル構造)や 1 次元 PC(多層膜)を加熱して熱輻射を観測する実験が多数行われた<sup>30-34)</sup>. その結果,完全 PBG 波長内では熱輻射の抑制が確認できたが,バンド端において状態密度の増大により熱輻射が増大することがわかった. 以上のように 2000 年代を通じて様々なナノ・マイクロ構造により熱輻射制御が実証されている. 2011 年までの MCA と PC の構造体は系統的にまとめられた文献を参照のこと<sup>7)</sup>.



Fig. 3 Nano/micro-structures for thermal radiation control: (a) 1D MCA (deep grating), (b) 2D MCA, (c) PC, (d) a single meta-atom of the first metamaterial PA, (e) plasmonic metasurface PA composed of cylindrical MDM meta-atoms, and (f) HMM (metal/dielectric multilayers).

## 4. マイクロ共振器,表面波による熱輻射制御

MCA を加熱するとどのような熱輻射スペクトルとな るか実験をみてみよう. 熱輻射制御用の MCA は高温に 耐えて光を強く閉じ込めるため高融点金属で作製される. MCA 構造の模式図を Fig. 4(a) に示す. これは金属表面 に直方体の穴(一辺 a, 深さ h, 周期 P)を周期的にあけ たものである. タンタル(Ta) 基板の表面を平らに研磨し, 電子ビーム露光とドライエッチングにより直方体型の MCA を作製した<sup>27)</sup>. ここでは共振器の開口面積が単位 格子中に占める割合が大きいもの( $a = 5.5 \mu$ m,  $h = 3.2 \mu$ m,  $P = 7.5 \mu$ m) と小さいもの( $a = 2.5 \mu$ m,  $h = 3.2 \mu$ m,  $P = 5 \mu$ m)の2種類を作製した. 開口部の割合はそれぞれ 54%, 25% である. Fig. 4(b) および(c) に作製した構造 の SEM 像を示す.

基板は真空容器中で750Kに通電加熱し,FT-IRにより熱輻射スペクトルを計測した.また,MCAを形成していない平面基板のスペクトルも同一温度で計測し, MCAとの比をとったものを相対輻射率(relative emissivity)としてFig.4(d),(e)に示す.まず相対輻射率>1で あり1を超えていることに注意してほしい.これは平面 基板より熱輻射が増大していることを示すが,なぜ共振 器QEDによる抑制が起きないのだろうか?答えは簡単 で,同一温度で計測しているためである.MCA基板は 平面基板と比べて輻射率が増大しているから,一種の放 射冷却がおきて温度が上がりにくく,同じ温度にするた めMCA基板に入力電力を多く投入している.実際,加 熱の電力を同一にして実験を行うと,相対輻射率<1と なって熱輻射の抑制を実験的に観測できる<sup>3)</sup>.

Fig. 4(d), (e)からスペクトルは開口の割合に依存して大きく異なることがわかる.開口が大きい場合は

Fig. 4(d) に示すように多数のブロードなピークが観測さ れる. 矢印は直方体のマイクロ共振器中の共振波長の理 論値であり,実験とよく一致している<sup>27)</sup>. したがって 共振モードのうち外部の放射場と結合できるモードによ る熱輻射の増大がおきたといえる. 一方,開口の割合が 小さくなり側壁部分が大きくなると,壁面上に熱励起さ れた表面波である表面プラズモンポラリトン(Surface Plasmon Polariton: SPP)の効果が現れる. SPP の分散曲線 は SPP 共振周波数において大きな波数の発散を引き起 こす. これは状態密度の発散を意味するから,熱輻射の 励起の大部分は MCA の共振モードではなく SPP に集中 する.

真空・金属(負誘電体)の界面を伝搬する SPP の波数β は

$$\beta = \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\varepsilon_{\rm m}}{1 + \varepsilon_{\rm m}}} \tag{8}$$

で与えられる<sup>35)</sup>. ここで,  $\varepsilon_{\rm m}$ は金属の比誘電率(<0)で ある.いま x-y 方向の周期がそれぞれ  $L_{\rm x}$ ,  $L_{\rm y}$ の2次元 MCA を考える.表面に熱励起された SPP は以下の波数 整合条件が満たされる方向の伝搬光と結合し,遠方場に 輻射される<sup>27)</sup>.

$$k_{\prime\prime\prime} = \beta + mg_{\rm x} + ng_{\rm y} \tag{9}$$

ここで、 $k_{//}$ は輻射伝搬光の波数ベクトルの表面への射 影ベクトル、 $\beta$ は(8)式で与えられる SPP の波数ベクト ル、 $g_x$ 、 $g_y$ はそれぞれ MCA を回折格子とみたときのx軸、y 軸方向の逆格子ベクトルで $|g_x| = 2\pi/L_x$ ,  $|g_y| = 2\pi/L_y$ , m, n は整数 $(m, n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \cdots)$ , である. Fig. 4(e) に 観測される狭帯域ピークの波長は(8)式, (9)式と(m, n)= (1, 0), (0, 1), (1, 1)において良く一致することから、回



Fig. 4 Thermal radiation from MCAs: (a) schematic of MCA, (b) SEM image of sample A:  $a = 5.5 \,\mu\text{m}$ ,  $h = 3.2 \,\mu\text{m}$ ,  $P = 7.5 \,\mu\text{m}$ , (c) SEM image of sample B:  $a = 2.5 \,\mu\text{m}$ ,  $h = 3.2 \,\mu\text{m}$ ,  $P = 5 \,\mu\text{m}$ , and relative emissivity spectra of (d) sample A and (e) sample B at 750 K. Up and down arrows in (d) and (e) indicate theoretical wavelengths of SPP resonance and openend micro-cavity resonance, respectively. (Reprinted with modified in permission from F. Kusunoki, J. Takahara, and T. Kobayashi: Electronics Lett. **39** (2003) 23).<sup>27)</sup>

折格子を介して熱励起された SPP が遠方場へ輻射されることがわかる。

以上より MCA の熱輻射制御においては表面波も含め たあらゆる励起モードを考慮する必要があることがわか る.特に共振器の深さが波長に比べて浅い場合には、表 面波の効果がさらに顕著に表れる.シリコンカーバイド (SiC)の表面に形成した浅い回折格子において表面波に よる指向性の高い熱輻射が報告されている<sup>8)</sup>.これは高 温においても表面波の位相が数周期にわたって保持され ていることを意味している.ただし、この表面波は SiC の Reststrahlen バンドに起因するフォノン由来の負誘電 体によるものであり、表面波は表面フォノンポラリトン (Surface Phonon Polariton: SPhP)である.SPhP は近年フォ ノニクスにおいてナノ領域の熱伝導を増大させることか ら注目を集めている<sup>36)</sup>.

MCA や PC においてはナノ構造の壁の表面からの輻射が残るため、輻射率を $\varepsilon'(\omega) = 0$ にすることは困難である. 2000 年代の研究でわかったことは、共振器 QED 効果による熱輻射抑制よりはむしろ金属基板を用いて背景輻射を抑制しながら、必要な周波数において完全吸収  $(A(\omega) = 1)$ を実現する方が容易であり、応用上の効果は同じであるという点である. エネルギー保存則から自明であるが、入力電力一定の条件下では輻射率を最大化すると、それ以外の輻射は抑制されるからである. そこで以下では完全吸収体について述べる.

#### 5. 完全吸収体とメタマテリアル

完全吸収体(Perfect Absorber: PA)とはある特定の周波 数の光の吸収率=1である物体のことであり,2節で述 べた黒体とは異なる.いま真空中に置いた複素屈折率n'=n-i $\kappa$ (n は屈折率, $\kappa$  は消衰係数)の均一な薄膜を考えて, これに角周波数 $\omega$ の光を垂直入射する.薄膜表面には 凹凸はなく、フラットであるとする.このとき薄膜の垂 直反射率 $R(\omega)$ ,透過率 $T(\omega)$ ,吸収率 $A(\omega)$ とすると  $R(\omega) + T(\omega) + A(\omega) = 1$ である.ただし、もし薄膜に周 期構造や平面内の不均一性などがあると、回折や散乱に より反射・透過に斜め成分が出る.この場合は反射率と 透過率を半球面において角度積分して再定義する必要が ある.

PA は  $A(\omega) = 1$  であるから  $R(\omega) + T(\omega) = 0$  より, PA は  $\omega$  において無反射 ( $R(\omega) = 0$ ) かつ不透明 ( $T(\omega) = 0$ ) で なければならない. 薄膜を金属基板上に形成すると不透 明となるから PA は無反射にするだけでよい. 金属基板 を用いた PA はステルス技術としての長い歴史があり,  $\lambda/4$  無反射膜を用いた Salisbury スクリーンが知られてい る<sup>2</sup>). これは破壊的干渉効果を利用して無反射を実現し た例である.

2008 年にはメタマテリアル (metamaterial) を用いた新 しい原理の PA が提案,実証された.この方法はインピー ダンス整合により無反射を実現する<sup>37-39)</sup>.メタマテリア ルはメタ原子とよばれる波長 λ より十分小さな人工共 振器(<< λ) を多数並べたものであり,光に対しては有効 屈折率をもつ有効媒質としてふるまう<sup>40,41)</sup>. メタマテリ アルの波動インピーダンスηは以下のようにあらわさ れる.

$$\eta(\omega) = \sqrt{\frac{\mu_{\text{eff}}(\omega)}{\varepsilon_{\text{eff}}(\omega)}} Z_0 \tag{10}$$

ここで、 $\varepsilon_{eff}(\omega)$ ,  $\mu_{eff}(\omega)$ はそれぞれメタマテリアルの有効比誘電率、有効比透磁率 $Z_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0} \sim 377 \Omega$ は真空の波動インピーダンス、 $\varepsilon_0$ は真空の誘電率(8.854×10<sup>-12</sup> F/m)、 $\mu_0$ は真空の透磁率( $4\pi \times 10^{-7}$  H/m)である. 天然の材料では赤外~可視域では比透磁率 $\mu_r = 1$ であるから、様々な値をとる比誘電率 $\varepsilon_r$ との整合をとることは難しい、メタマテリアルを用いるとメタ原子の構造を変えることで $\varepsilon_{eff}(\omega)$ と $\mu_{eff}(\omega)$ を独立に設計できるので、 $\varepsilon_{eff}(\omega) = \mu_{eff}(\omega)$ とすることができる.これにより真空とのインピーダンス整合がとれ無反射を実現できる.

Fig. 3(d) にメタマテリアル PA のメタ原子を示す<sup>38)</sup>. ここでメタ原子は電気リング共振器と金属線から構成される.Fig. 3(d) に示す向きで直線偏光を入射するとリン グ共振器が電気共振を,リング共振器と金属線との間に 変位電流による磁気共振を示す.サイズパラメータを変 化させインピーダンス整合をとり,同時に共振による損 失増大により透過を抑制する.これによりマイクロ波 11.5 GHz( $\lambda$  = 26 mm) において波長に比べて十分薄い 750 µm( $\lambda$ /35)厚の狭帯域 PA(A = 0.88)を実現した.ただ し、単層では 1% 程度の透過率があるので、複数層重ね ることで波長以下の厚さの PA(A = 1)となる.同様の原 理でテラヘルツ波 1.6 THz( $\lambda$  = 190 µm)や中赤外光( $\lambda$  = 6 ~ 8 µm)の PA も実現された<sup>42,43</sup>).

## メタマテリアル / メタサーフェス完全吸収体による 熱輻射制御

PA で熱輻射制御を行うにはこれを加熱する必要があ る.5節に述べたメタマテリアルの3次元構造は作製が 困難で,材料も高温動作に向いていない.このため赤外 ~可視域では2次元メタマテリアルであるメタサーフェ ス(metasurface)を用いる方が良い.

メタサーフェスの PA の実現のためには、単一のメタ 原子(プラズモニック共振器)の吸収断面積 C<sub>abs</sub> が共振 周波数において幾何学的断面積 Sより非常に大きくなる 現象(C<sub>abs</sub>≫S)を利用する<sup>2,35)</sup>. MDM パッチ型メタ原子 を例にとり、原理を Fig. 5 に模式的に示す<sup>2)</sup>. Fig. 5(a) に示すように共振周波数においてメタ原子は漏斗のよう に光を集めて吸収する機能をもつ.光のポインティング ベクトルがメタ原子に吸い込まれる様子がシミュレー ションにより得られている<sup>44,45)</sup>. このようなメタ原子を 多数用意して、共振条件の C<sub>abs</sub>の面積をもつ円が相互 に重なるように平面に並べると入射するすべてのフォト ンを吸収する PA になると予測できる(Fig. 5(b)).

キルヒホッフの法則から Fig. 5(a) の系はスーパープ ランキアンでもある<sup>12)</sup>. 最近, 波長以下の単一のナノ 物体が遠方場でスーパープランキアンになることが観測



Fig. 5 Schematic principles of PA by metasurface at farfield: absorption cross-sections by (a) a single meta-atom and (b) a super-cell of meta-atoms. (a)a plasmonic meta-atom (an MDM patch nanodisk) is irradiated by light at resonant wavelength with  $C_{abs} >> S$ . (b) multiple meta-atoms of (a) are arranged in a super-cell where  $C_{abs}$  is overlapped each other with  $C'_{abs} \sim S'$ .

されている<sup>46)</sup>.しかし、Fig.5(a)を多数集めてスーパー セル化し、熱平衡状態に置いた系の吸収断面積 C'<sub>abs</sub> は スーパーセルの幾何学的面積 S'とほぼ等しくなり、そ れを超えることはない(C<sub>abs</sub>の円の重なり領域でフォト ンが2倍吸収されるわけではなく、どちらかのメタ原子 に吸収されるため).Fig.5(b)にキルヒホッフの法則を 適用して輻射とみれば、熱平衡状態にあるスーパーセル からの熱輻射がスーパープランキアンではなく黒体輻射 になることが直観的にもわかる<sup>12)</sup>.

Fig. 3(e)にメタサーフェスによる PA の構造例を示す. これはメタ原子として金属・誘電体・金属(Metal-Dielectric-Metal: MDM)構造のパッチ型プラズモニック 共振器を用いたメタサーフェスである<sup>47-50)</sup>. このプラズ モニック共振器は SPP に対する横型のファブリペロー (Fabry-Pérot: FP)共振器であり,外部光を出し入れする 光アンテナでもある. この共振モードをギャップ表面プ ラズモン(Gap Surface Plasmon: GSP)とよぶ<sup>49)</sup>. ギャッ プ間距離を波長より小さくすると GSP の伝搬損失が大 きくなり,光アンテナに捕獲された光は吸収され熱にな る(光熱変換).

2008 年に MDM 構造を持つメタサーフェス型 PA が狭 帯域熱輻射エミッターにはじめて利用された<sup>50,51)</sup>.2010 年代に入ると MDM 構造をベースとした狭帯域中赤外光 源が多数報告されるようになった<sup>52-54)</sup>.ガスセンシング 応用のため二つの指紋波長を同時に輻射できる中赤外光 源が実現されている<sup>55,56)</sup>.最近では1m<sup>2</sup>の大面積中赤 外光源も作製されている<sup>57)</sup>.

近年では高い融点と貴金属に近い負誘電率を兼ね備え た窒化物セラミクス(TiN, HfN など)が高融点プラズモ ニック材料(refractory plasmonic material)として登場した ことで,貴金属が中心のプラズモニクスで培われた成果 を熱輻射光源に応用できるようになった. Fig. 6(a)に HfN を用いたメタサーフェス PA からの熱輻射の実験例 を示す<sup>4)</sup>. これは HfN を金属層, SiO<sub>2</sub> を誘電体層とし て用いた MDM 型メタサーフェスである(Fig. 6(b)). Fig. 6(c)に温度 573 K における熱輻射スペクトルを示す.



Fig. 6 Thermal radiation from refractory plasmonic metasurface: (a) schematic of MDM metasurface consisting of HfN and SiO<sub>2</sub> and (b) SEM image of top view of HfN meta-atoms, (c) thermal radiation spectra at 573 K from metasurface (experiment) and blackbody (calculation). (Reprinted with modified from H. Toyoda, K. Kimino, A. Kawano, and J. Takahara: Photonics 6 (2019) 105.<sup>4</sup>)

中赤外(波長 4.2 μm)において 0.99 を超える高い輻射率 が得られている.また,同一温度の黒体輻射と比較する と,黒体であれば輻射されるはずの長波長側の輻射が抑 制されている.このように PA により特定波長の熱輻射 のみを黒体レベルまで最大化できることが現在の熱輻射 制御の特徴である.

メタサーフェス型 PA の利点はメタ原子のサイズを変 更するだけで可視域から赤外域まで輻射ピーク波長を幅 広く変えることができる点である.このときQ値を上 げることにより単色性を高めたいが,MDM型メタ原子 のQ値は1~10のオーダーでありそれほど高くできな い.Q値の高い狭帯域赤外光源として SPP,SPhP,疑 似表面プラズモン等の表面波を利用したものがあ る<sup>27,8,58)</sup>.しかし,表面波を輻射として取り出すには4 節に述べた回折格子による波数整合を必要とするから, 角度依存性が強い.高いQ値を持つものとして PC とサ ブバンド間吸収を制御した半導体赤外光源や,Tammプ ラズモンを用いた角度依存性の少ない狭帯域赤外光源な どが報告されている<sup>59,60)</sup>.最近,機械学習による金属 基板上の誘電体多層膜の構造最適化により極めて高い Q~200 をもつ狭帯域赤外光源が実現された<sup>61)</sup>.

廃熱回収や放射冷却などへの応用のためには、狭帯域 化よりむしろ広帯域化が重要である.これには Fig. 3(f) に示すハイパボリック・メタマテリアル(Hyperbolic Metamaterial: HMM)を用いた PA が注目されている<sup>62)</sup>. HMM は金属(負誘電体)と誘電体の多層膜(<<A)により 実現される有効媒質でありユニークな分散関係を示すこ とで知られている(金属ロッドアレイもあるがここでは 取り上げない)<sup>63)</sup>. 光の分散関係は誘電体媒質中では波 数空間(k 空間)において球面であるが, HMM では双曲 面(hyperboloid)となることからこの名前が付いた. HMM の大きな特徴はバルク伝搬波(Bulk Propagating Wave: BPW)とよばれる SPP に起源をもつ波がバルク中 を伝搬できることである<sup>64)</sup>. BPW の波数は k 空間の双 曲面では波数の上限がなくなるため,(無損失の場合に は)k=∞にできる.このため HMM をメタ原子とする場 合には、外部からどんな角度で入射光kが入射しても BPW が励起され、SPP 由来の高い吸収率で直ちに吸収 されることを意味する. SPP も $k = \infty$ の領域で損失が極 めて大きくなるが、表面波のため結合は容易ではない. HMM は SPP と誘電体中のバルク波の良い点を兼ね備え ており回折限界の制約を受けないので、もし損失の大き さを軽減することができれば、将来的には輻射制御にと どまらずナノ光集積回路などへの展開が期待できる<sup>64,65)</sup>.

#### 7. まとめ

ナノ・マイクロ構造による熱輻射制御の原理を俯瞰的 に紹介した. MCA や PC をはじめとしてメタマテリア ル,メタサーフェスによる遠方場での熱輻射スペクトル 制御が既に実現されている.また近年,熱伝導において もフォノニック結晶によって熱の流れをフォノンとして 制御できるようになった<sup>66)</sup>.このようにナノ領域の熱 の制御はフォトニクスとフォノニクスが融合する時代に 入りつつある.遠方場にとどまらず,表面波や近接場輻 射伝熱を積極的に活用して,TPV 発電,廃熱回収や放 射冷却などへの応用をすすめることにより持続可能な社 会へ貢献することが我々に求められている.

### 参考文献

- 1) JSME: Heat Transfer (JSME Textbook Series) (Maruzen, 2005) Ch. 4 (in Japanese).
- 日本機械学会: 伝熱工学(JSME テキストシリーズ)(丸善, 2005) Ch.4.
- 2) J. Takahara: KOGAKU 47 (2018) 358 (in Japanese). 高原 淳一:光学 47 (2018) 358.
- 3) J. Takahara, Y. Ueba, and T. Nagatsuma: KOGAKU **39** (2010) 482 (in Japanese).
  - 高原 淳一, 上羽 陽介, 永妻 忠夫:光学 **39** (2010) 482.
- 4) H. Toyoda, K. Kimino, A. Kawano, and J. Takahara: Photonics 6 (2019) 105.
- 5) D. G. Baranov, Y. Xiao, I. A. Nechepurenko, A. Krasnok, A. Alù and M. A. Kats: Nature Mat. 18 (2019) 920.
- 6) Nano/Microscale Thermophysical Properties Handbook, JSTP (ed.) (Yokendo, 2014) Sec. 3.4 (in Japanese). ナノ・マイクロスケール熱物性ハンドブック, 日本熱物性
- 学会編(養賢堂, 2014)3.4 節. 7) Nano/Microscale Thermophysical Properties Handbook, JSTP
- (ed.) (Yokendo, 2014) Sec. 6.5 (in Japanese).
   ナノ・マイクロスケール熱物性ハンドブック,日本熱物性
   学会編(養賢堂, 2014) 6.5 節.
- 8) J.-J. Greffet, R. Carminati, K. Joulain, J.-P. Mulet, S. Mainguy, and Y. Chen: Nature 416 (2002) 61.
- 9) E. Rousseau, A. Siria, G. Jourdan, S. Volz, F. Comin, J. Chevrier, and J.-J. Greffet: Nat. Photonics 3 (2009) 514.
- 10) B. Song, D. Thompson, A. Fiorino, Y. Ganjeh, P. Reddy, and E. Meyhofer: Nat. Nanotec. 11 (2016) 509.
- 11) S.-Y. Lin, M.-L. Hsieh, S. John, B. Frey, J. A. Bur, T.-S. Luk, X. Wang, and S. Narayanan: Sci. Rep. 10 (2020) 5209.
- 12) Y. Xiao, M. Sheldon, and M. A. Kats: Nature Photon. 16 (2022) 397.
- 13) M. Planck: Vorlesungen über die Theorie der Wärmestrahlung (Johann Ambrosius Barth, 1906) (in Japanese). M. Planck: 熱放射理論の講義(若野省己訳)(丸善出版, 2021).
- 14) Nano/Microscale Thermophysical Properties Handbook, JSTP (ed.) (Yokendo, 2014) Sec. 2.3 (in Japanese).
  ナノ・マイクロスケール熱物性ハンドブック, 日本熱物性
  学会編(養賢堂, 2014) 2.3 節.

- 15) A. I. Volokitin and B. N. J. Persson: Rev. Mod. Phys. **79** (2007) 1291.
- 16) E. M. Purcell: Phys. Rev. 69 (1946) 681.
- 17) R. G. Hulet, E. S. Hilfer, and D. Kleppner: Phys. Rev. Lett. 55 (1985) 2137.
- 18) D. J. Heinzen, J. J. Childs, J. E. Thomas, and M. S. Feld: Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 1320.
- 19)E. Hanamura: Quantum Optics (Iwanami Shoten, Publishers, 1992) Ch.2 (in Japanese).
- 花村 榮一:量子光学(岩波書店, 1992年)2章.
- 20) E. Hanamura and M. Yamanishi: *Sel. Papers in Physics IX, Quantum Manipulation of Radiation Field and Matter* (JPS, 1997) p. 12 (in Japanese).
  - 花村 榮一,山西 正道:物理学論文選集 IX 輻射場と粒子の 量子制御(日本物理学会編, 1997) p. 12.
- 21) T. Kobayashi, T. Segawa, A. Morimoto, and T. Sueta: Extended Abstracts of 4<sup>th</sup> JSAP Annual Meeting (1982) p. 127 (in Japanese). 小林 哲朗, 瀬川 太郎, 森本 朗裕, 末田 正: 第4回応用物 理学会学術講演会予稿集 (1982) p. 127.
- 22) E. Dimopoulos, A. Sakanas, A. Marchevsky, M. Xiong, Y. Yu, E. Semenova, J. Mørk, and K. Yvind: Laser Photonics Rev. 16 (2022) 220010.
- 23) R.-M. Ma and S. Y. Wang: Nanophotonics 10 (2021) 3623.
- 24) P. J. Hesketh, J. N. Zemel, and B. Gebhart: Nature **324** (1986) 549.
- 25) J. F. Waymouth: J. Illum. Engng. Jpn. 74 (1990) 800 (in Japanese). J. F. Waymouth: 照明学会誌 74 (1990) 800.
- 26) S. Maruyam T. Kashiwa, H. Yugami, and M. Esashi: Appl. Phys. Lett. 79 (2001) 1393.
- 27) F. Kusunoki, J. Takahara, and T. Kobayashi: Electron. Lett. 39 (2003) 23.
- 28) H. Sai, Y. Kanamori, and H. Yugami: Appl. Phys. Lett. 82 (2003) 1685.
- 29) F. Kusunoki, J. Takahara, and T. Kobayashi: Jpn. J. Appl. Phys. 43 (2004) 5253.
- 30) S. Y. Li, J. G. Fleming, E. Chow, Jim Bur, K. K. Choi, and A. Goldberg: Phys. Rev. B 62 (2000) R2243.
- 31) J. G. Fleming, S. Y. Lin, I. El-Kady, R. Biswas, and K. M. Ho: Nature 417 (2002) 52.
- 32) S. Y. Lin, J. Moreno, and J. G. Fleming: Appl. Phys. Lett. 83 (2003) 380.
- 33) P. Nagpal, S. E. Han, A. Stein, and D. J. Norris: Nano Lett. 8 (2008) 3238.
- 34) O. Ilic, P. Bermel, G. Chen, J. D. Joannopoulos, I. Celanovic, and M. Soljačić: Nat. Nanotech. 11 (2016) 320.
- 35) T. Okamoto and K. Kajikawa: *Plasmonics* (Kodansya, 2010) (in Japanese). 岡本 隆之, 梶川 浩太郎: プラズモニクス ~ 基礎と応用(講
- 談社, 2010). 36) Y. Wu, J. Ordonez-Miranda, S. Gluchko, R. Anufriev, D. De Sousa
- Meneses, L. Del Campo, S. Volz, and M. Nomura: Sci. Adv. 6 (2020) eabb4461.
- 37) C. M. Watts, X. Liu, and W. J. Padilla: Adv. Mater. 24 (2012) OP98.
- 38) N. I. Landy, S. Sajuyigbe, J. J. Mock, D. R. Smith, and W. J. Padilla: Phys. Rev. Lett. **100** (2008) 207402.
- 39) H. Tao, C. M. Bingham, A. C. Strikwerda, D. Pilon, D. Shrekenhamer, N. I. Landy, K. Fan, X. Zhang, W. J. Padilla, and R. D. Averitt: Phys. Rev. B 78 (2008) 241103(R).
- 40) T. Ishihara: *Technologies and Applications of Metamaterial* (CMC Books, 2007) (in Japanese). 石原 照也監修:メタマテリアル ~ 最新技術と応用 ~ (普及 版 メタマテリアルの技術と応用) (2007, CMC 出版).
- 41) J. Takahara: Metamaterial and metasurface design, manufacturing and application technologies (R&D Support Center, 2020) Ch. 1 (in Japanese).

高原 淳一:メタマテリアル,メタサーフェスの設計・作製 と応用技術 (R&D 支援センター, 2020) Ch. 1.

- 42) X. Liu, T. Tyler, T. Starr, A. F. Starr, N. M. Jokerst, and W. J. Padilla: Phys. Rev. Lett. **107** (2011) 045901.
- 43) B. J. Lee, L. P. Wang, and Z. M. Zhang: Opt. Express 16 (2008) 11328.
- 44) S. D. Rezaei, J. Ho, R. J. H. Ng, S. Ramakrishna, and J. K. W. Yang: Opt. Express 25 (2017) 27652.

- 45) M. F. Hainey, Jr., T. Mano, T. Kasaya, T. Ochiai, H. Osato, K. Watanabe, Y. Sugimoto, T. Kawazu, Y. Arai, A. Shigetou, *et al.*: Nanophotonics **9** (2020) 4775.
- 46) D. Thompson, L. Zhu, R. Mittapally, S. Sadat, Z. Xing, P. McArdle, M. M. Qazilbash, P. Reddy, and E. Meyhofer: Nature 561 (2018) 216.
- 47) J. Hao, J. Wang, X. Liu, W. J. Padilla, L. Zhou, and M. Qiu: Appl. Phys. Lett. 96 (2010) 251104.
- 48) M. G. Nielsen, D. K. Gramotnev, A. Pors, O. Albrektsen, and S. I. Bozhevolnyi: Opt. Express 19 (2011) 19310.
- 49) M. G. Nielsen, A. Pors, O. Albrektsen, and S. I. Bozhevolnyi: Opt. Express 20 (2012) 13311.
- 50) B. J. Lee, L. P. Wang, and Z. M. Zhang: Opt. Express 16 (2008) 11328.
- 51) I. Puscau and W. L. Schaich: Appl. Phys. Lett. 92 (2008) 233102.
- 52) Y. Ueba and J. Takahara: Appl. Phys. Express 5 (2012) 122001-1.
- 53)K. Ito, H. Toshiyoshi, and H. Iizuka: Opt. Express 24 (2016) 12803.
- 54) T. Yokoyama, T. D. Dao, K. Chen, S. Ishii, R. P. Sugavaneshwar, M. Kitajima, and T. Nagao: Adv. Opt. Mat. 4 (2016) 1987.
- 55) H. T. Miyazaki, T. Kasaya, M. Iwanaga, B. Choi, Y. Sugimoto, and K. Sakoda: Appl. Phys. Lett. 105 (2014) 121107.

- 56)H. Miyazaki and M. Iwanaga: Rev. Laser Eng. 44 (2016) 10 (in Jananese).
- 宮崎 英樹, 岩長 祐伸:レーザー研究 44 (2016) 10.
- 57) Y. Matsuno and A. Sakurai: Opt. Mat. Express 7 (2017) 618.
- 58) Y. Ueba, J. Takahara, and T. Nagatsuma: Opt. Lett. **36** (2011) 909. 59) M. De Zoysa, T. Asano, K. Mochizuki, A. Oskooi, T. Inoue, and S.
- Noda: Nat. Photonics 6 (2012) 535. 60)Z. Y. Yang, S. Ishii, T. Yokoyama, T. D. Dao, M.-G. Sun, T.
- Nagao, and K.-P. Chen: Opt. Lett. **41** (2016) 4453. 61) A. Sakurai, K. Yada, T. Simomura, S. Ju, M. Kashiwagi, H. Okada, T. Nagao, K. Tsuda, and J. Shiomi: ACS Cent. Sci. **5** (2019) 319.
- 62) M. M. Hossain, B. Jia, and M. Gu: Adv. Opt. Mater. **3** (2015) 1047.
- 63) A. Poddubny, I. Iorsh, P. Belov, and Y. Kivshar: Nat. Photonics 7 (2013) 948.
- 64) M. Higuchi and J. Takahara: Opt. Express 26 (2018) 1918.
- 65) O. Takayama and A. V. Lavineko: J. Opt. Soc. Am. B **36** (2019) F38.
- 66) M. Nomura, R. Anufriev, Z. Zhang, J. Maire, Y. Guo, R. Yanagisawa, and S. Volz: Mater. Today Phys. 22 (2022) 100613.